

HAUG Ionisation - zur Beseitigung elektrostatischer Ladungen



HAUG Ionisationssysteme

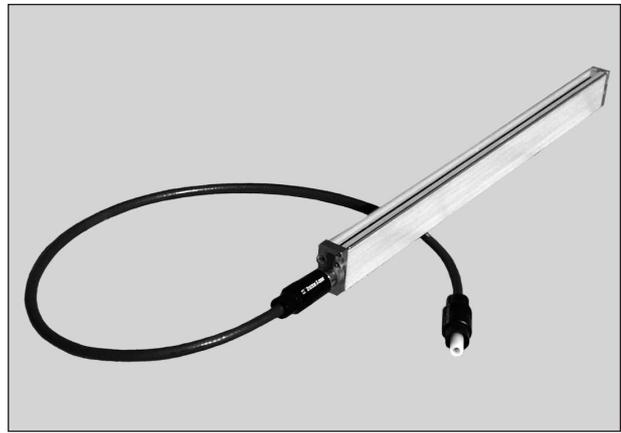
dienen zur Neutralisation elektrostatischer Aufladungen. Auf verschiedenen Materialbahnen können störende elektrostatische Ladungen entstehen. Sie behindern den Produktionsablauf und binden Staubpartikel sowie andere qualitätsmindernde Substanzen an sich. HAUG forscht, entwickelt und produziert seit 50 Jahren, um dieses Phänomen zu beherrschen.

Betroffen sind alle Industriebereiche, in welchen Materialien mit niedriger elektrischer Leitfähigkeit verarbeitet werden.

EI W

Der Ionisationsstab **EI W** (Foto) ist eine Neuentwicklung, die höchste Leistung mit hervorragender mechanischer Stabilität kombiniert. Zugleich wurde ein System geschaffen, das durch seinen modularen Aufbau ein hohes Maß an Flexibilität und Servicefreundlichkeit besitzt.

Der **EI W** beseitigt störende elektrostatische Aufladung doppelt so schnell wie der bisher leistungsstärkste Ionisationsstab. Dies gewährleistet auch bei schnelllaufenden Maschinen und hoher elektrostatischer Aufladung eine zuverlässige Wirkung. Der modulare Aufbau des **EI W** ermöglicht das einfache und schnelle Austauschen der Ionisationsspitzen. Als Standard werden Spitzen aus Edelstahl (Foto 2) verwendet. Für spezielle Anwendungsfälle, wie z.B. für den Einsatz des **EI W** in der Halbleiterfertigung, stehen Ionisationsspitzen aus Silizium (Foto 3) zur Verfügung.



EI W

HAUG Ionisationssysteme

bestehen aus folgenden Komponenten (Grafik 1):

- einem Netzteil mit integriertem Hochspannungstransformator und
- einem oder mehreren daran angeschlossenen Ionisationsgeräten, wie z.B. den Ionisationsstab **EI W**, die von dem Netzteil mit einer Spannung von 7-8 kV_~ versorgt werden.

Grafik 1

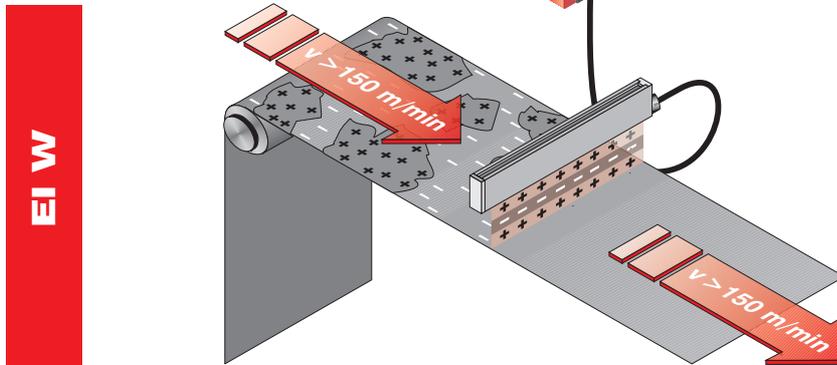
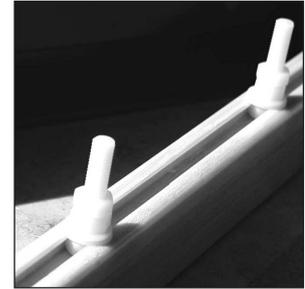
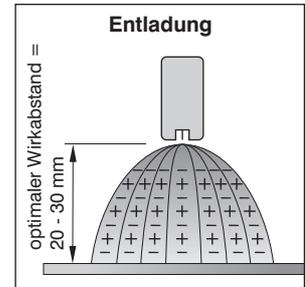


Foto 1



Grafik 2



Besondere Eigenschaften und Vorteile

- **servicefreundlich:** Der HAUG Ionisationsstab **EI W** besteht aus Einzelmodulen, jedes Teil ist austauschbar. Auch das Hochspannungskabel kann verlängert, verkürzt oder ausgewechselt werden.
- **größere Reichweite:** Durch die verbesserte Leistung kann der Ionisationsstab **EI W** auch in größerem Abstand zum Material angebracht werden.
- **Prozesskompatibilität:** Das Material der Ionisationsspitzen kann anwendungsspezifisch gewählt werden. Somit kann z.B. in der Halbleiterfertigung durch die Verwendung von Ionisationsspitzen aus Silizium das Risiko der Kontamination vermindert werden.

Branchen

- **Kunststoffverarbeitende Industrie:** Folienverarbeitung, Verpackungsmaschinen, Folienextruder, usw.
- **Textilindustrie:** Webereien, Spinnereien, Textilveredelung, usw.
- **Grafische Industrie:** Sieb- und Tampondruckmaschinen, Foto- und Filmverarbeitungsmaschinen, Falzmaschinen, usw.
- **Lackierbetriebe:** Automobillackierungen, Lackierungen von Kunststoffteilen, usw.
- **Elektronikfertigung:** Bestückung von Platinen mit elektronischen Bauteilen, Fertigung von Halbleiterbauteilen, Herstellung von Halbleitern.

HAUG GmbH & Co. KG

Deutschland

Friedrich-List-Str. 18
D-70771 Leinf.-Echterdingen
Telefon: +49 711 / 94 98-0
Telefax: +49 711 / 94 98-298

www.haug.de
E-mail: info@haug.de

HAUG Biel AG

Schweiz

Johann-Renfer-Str. 60
CH-2500 Biel-Bienne 6
Telefon: +41 32 / 344 96 96
Telefax: +41 32 / 344 96 97

www.haug-ionisation.com
E-mail: info@haug-biel.ch



**Foto 2**

Spitzen aus Edelstahl

Foto 3

Spitzen aus Silizium

EI W**Technische Daten EI W**

Type:	EI W	Best.-Nr.: 03.9011.000
	widerstandsgekoppelt, mit axialem Kabelanschluss	
	HS-Kabel	Best.-Nr.: 02.8522.000
Maße:	25 x 45 mm (B x H)	
Länge:	80 mm – 2000 mm	
Einsatztemperatur:	+5 °C bis +45 °C	
Lager-/Transporttemperatur:	-15 °C bis +60 °C	
Optimaler Wirkabstand:	20 – 30 mm (Grafik 2)	
Wirklänge:	Stablänge - 60 mm	
Kleinster Biegeradius (Kabel):	R 50	

Technische Änderungen vorbehalten!

Zubehör

Stabhalter Best.-Nr.: X-0423

Geeignete Netzteile

Anschlusslängen (Ionisationsgerät inkl. HS-Kabel):

EN SL	max. 5 m
EN SL LC / EN SL RLC	max. 10 m
EN 8 / EN 8 LC	max. 18 m
Multistat	max. 18 m
EN 70 / EN 70 LC	max. 2 x 18 m

